

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003年3月13日 (13.03.2003)

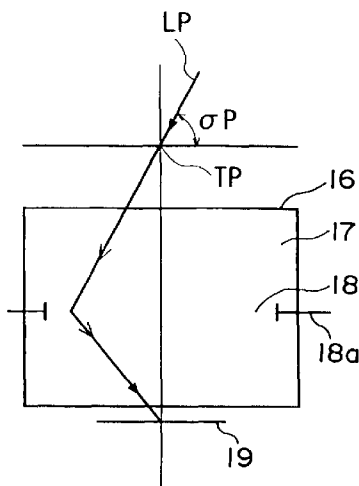
PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/021352 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G03F 1/08, 7/22, H01L 21/027, G01M 11/02
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/06995
- (22) 国際出願日: 2002年7月10日 (10.07.2002)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2001-264581 2001年8月31日 (31.08.2001) JP
特願2001-264582 2001年8月31日 (31.08.2001) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): キヤノン株式会社 (CANON KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒146-8501 東京都大田区下丸子三丁目30番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 塩出 吉宏 (SH-IODE, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒320-0011 栃木県宇都宮市富士見が丘二丁目16番9号 Tochigi (JP).
- (74) 代理人: 山田 隆一 (YAMADA, Ryuichi); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目7番7号 長谷川ビル4F 東晃国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, SG, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: RETICLE AND OPTICAL CHARACTERISTIC MEASURING METHOD

(54) 発明の名称: レチクル及び光学特性計測方法



(57) Abstract: A reticle (16) having a test pattern (TP) for measuring the optical characteristics of a projection optical system (17), wherein the test pattern (TP) has a pattern by which the high frequency components of the spectrum on a pupil surface (18) of the projection optical system are reduced or suppressed. The optical characteristics of the projection optical system (17) are measured by applying an illumination light to the test pattern of the reticle (16) in one direction or in a plurality of directions, and detecting the position of an image of the test pattern (TP) formed based on the irradiation from each of the plurality of directions.



(57) 要約:

投影光学系（１７）の光学特性を計測するためのテストパターン（ＴＰ）を持つレチクル（１６）は、前記テストパターン（ＴＰ）は、前記投影光学系の瞳面（１８）におけるスペクトルの高周波数成分が減少又は抑制されるパターンを有する。レチクル（１６）のテストパターンに一方向或いは複数の方向から照明光を照射し、該複数の方向のそれぞれからの照射に基づき形成される前記テストパターン（ＴＰ）の像の位置を検出することにより前記投影光学系（１７）の光学特性を計測する。